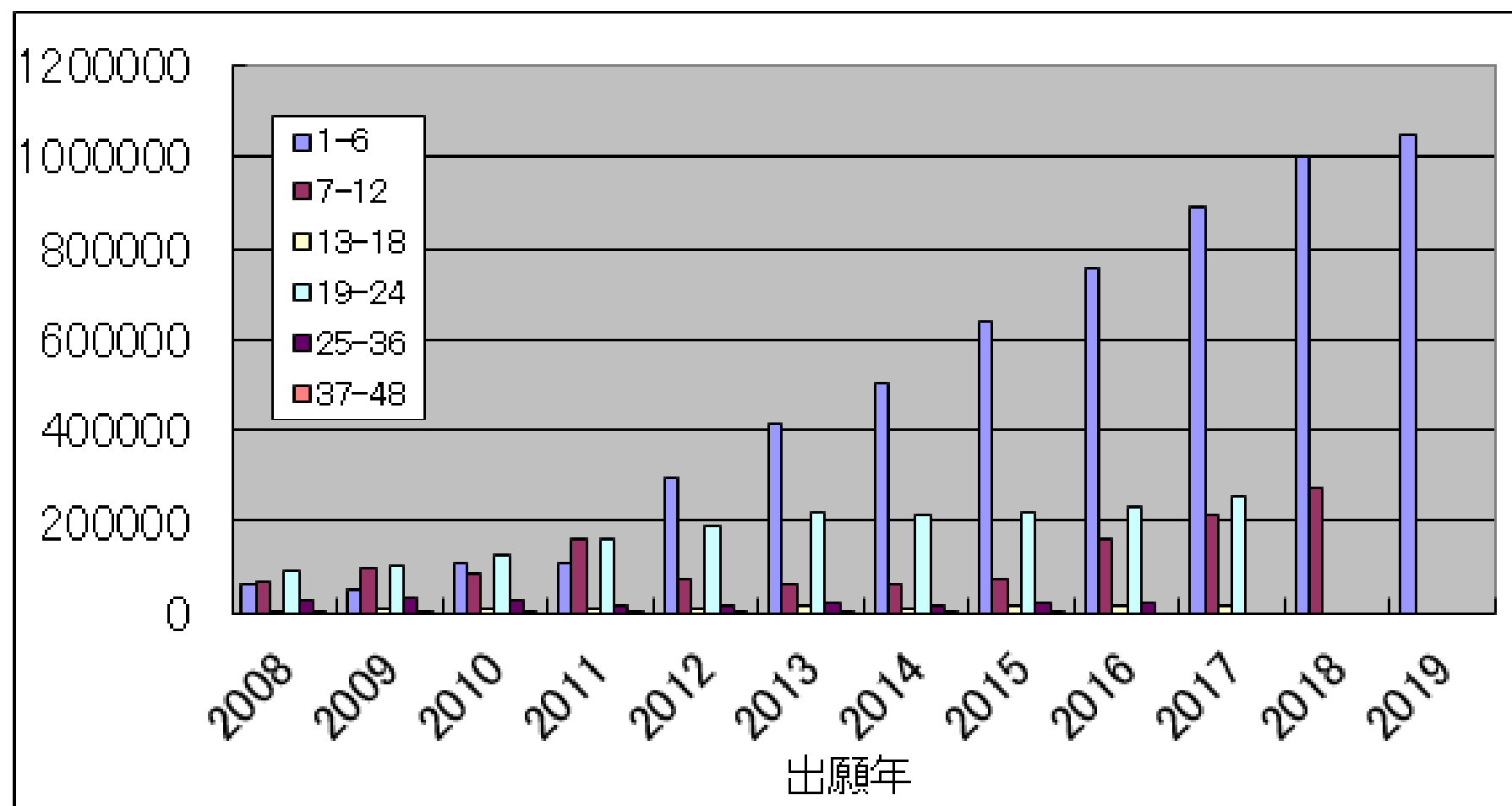


図2: 中国早期公開特許



凡例中の数字は、出願～公開までの月数

圖3: 中国登録特許

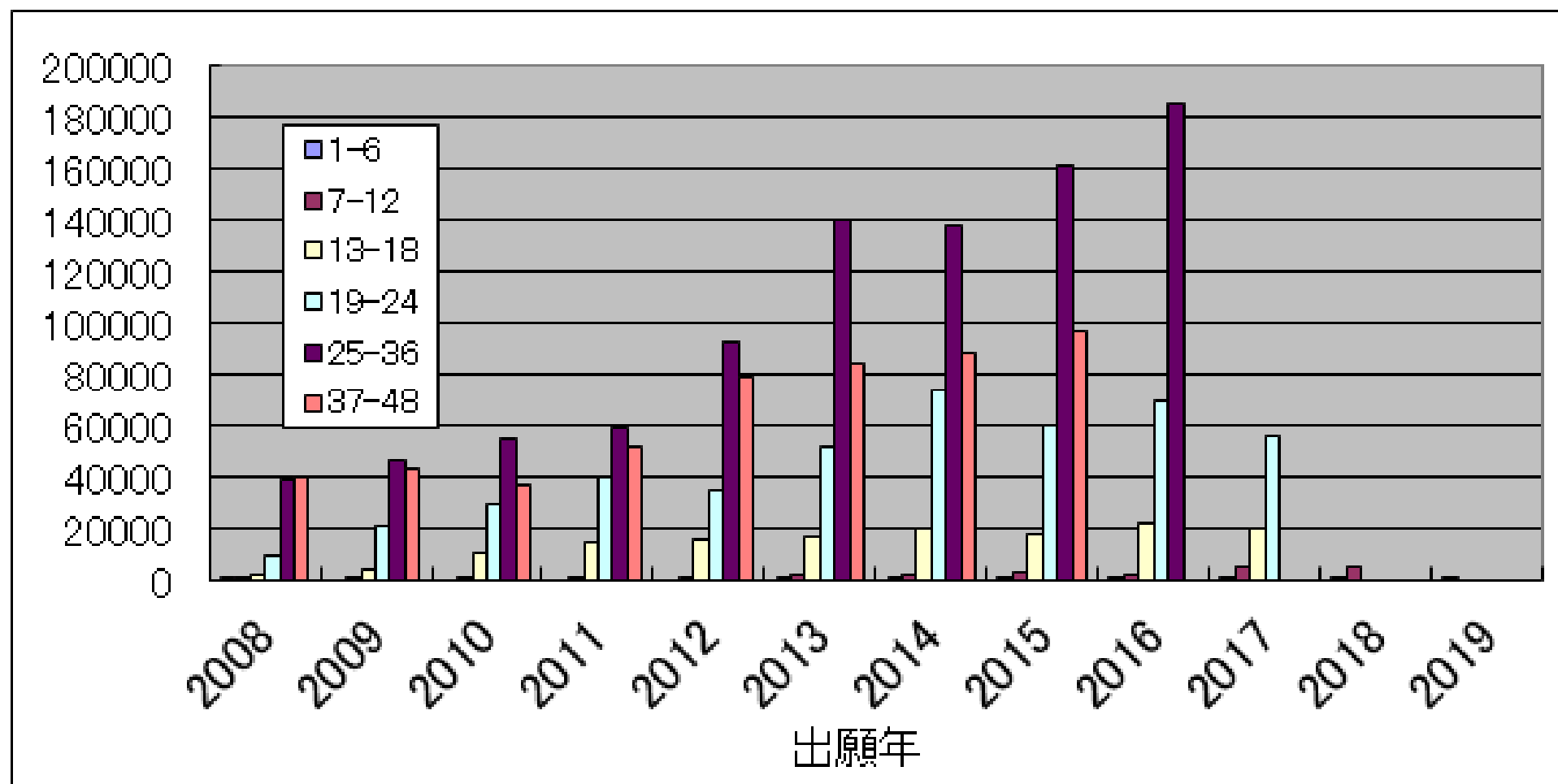


図4. 実用新案

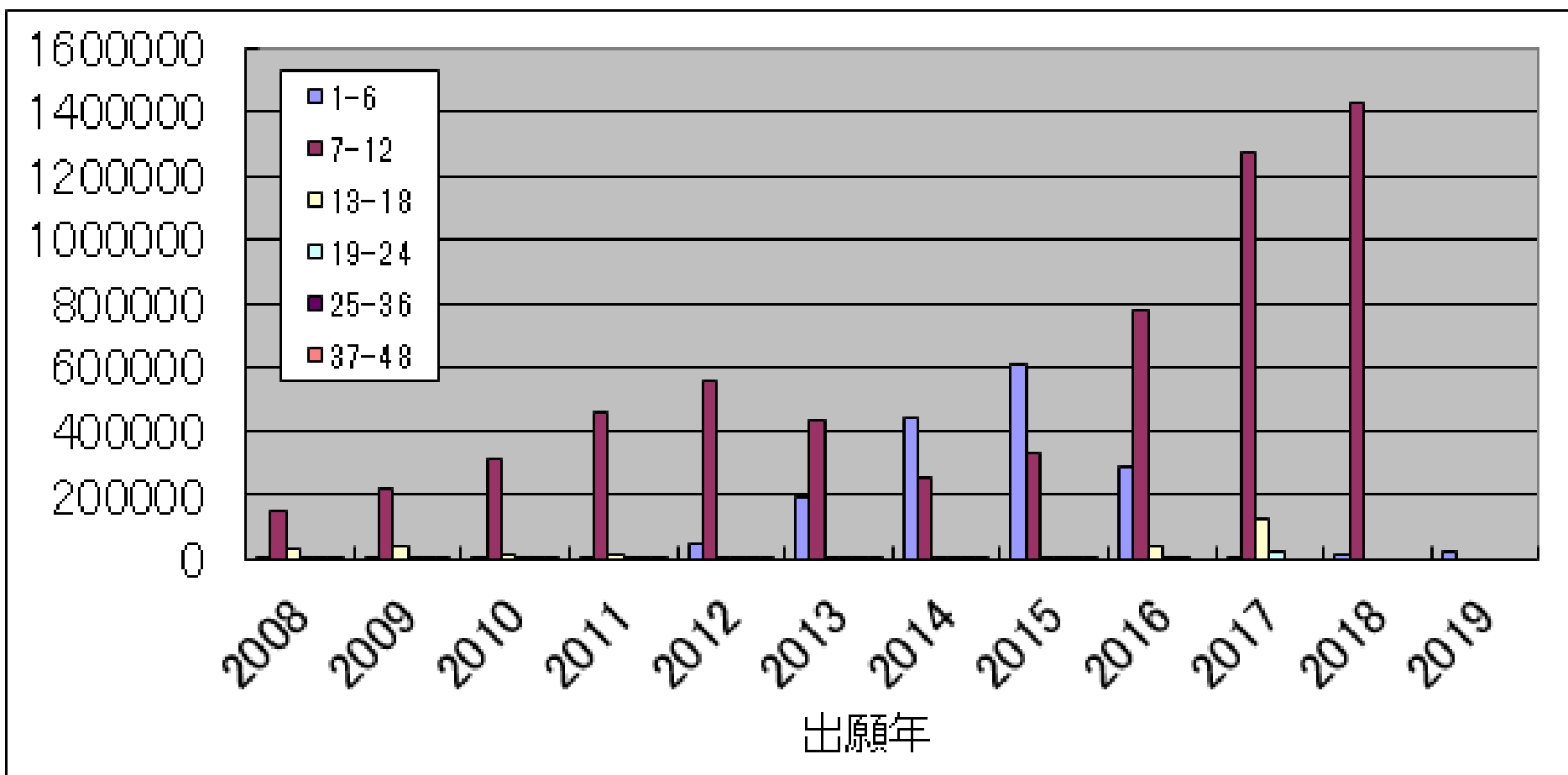
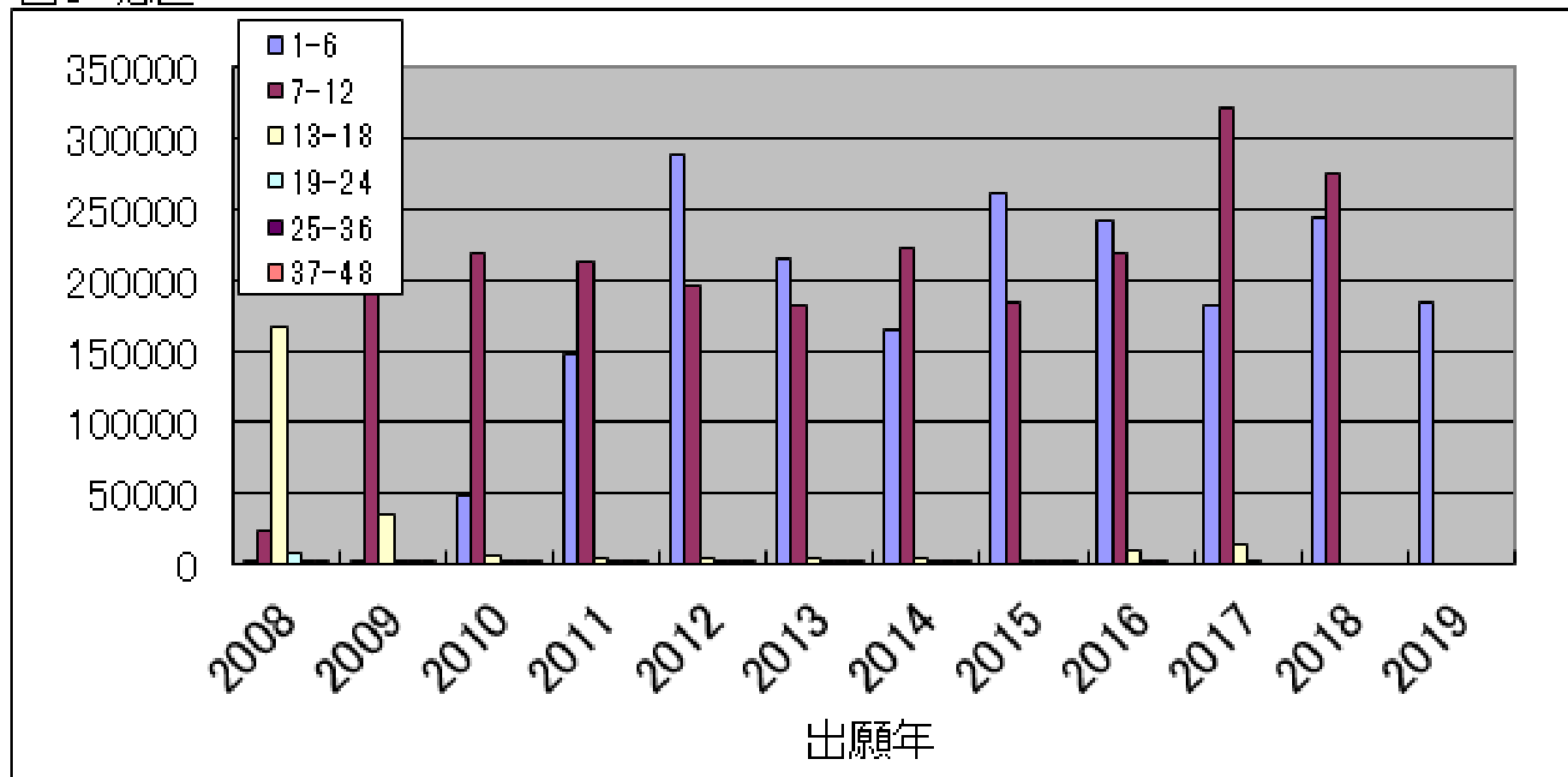
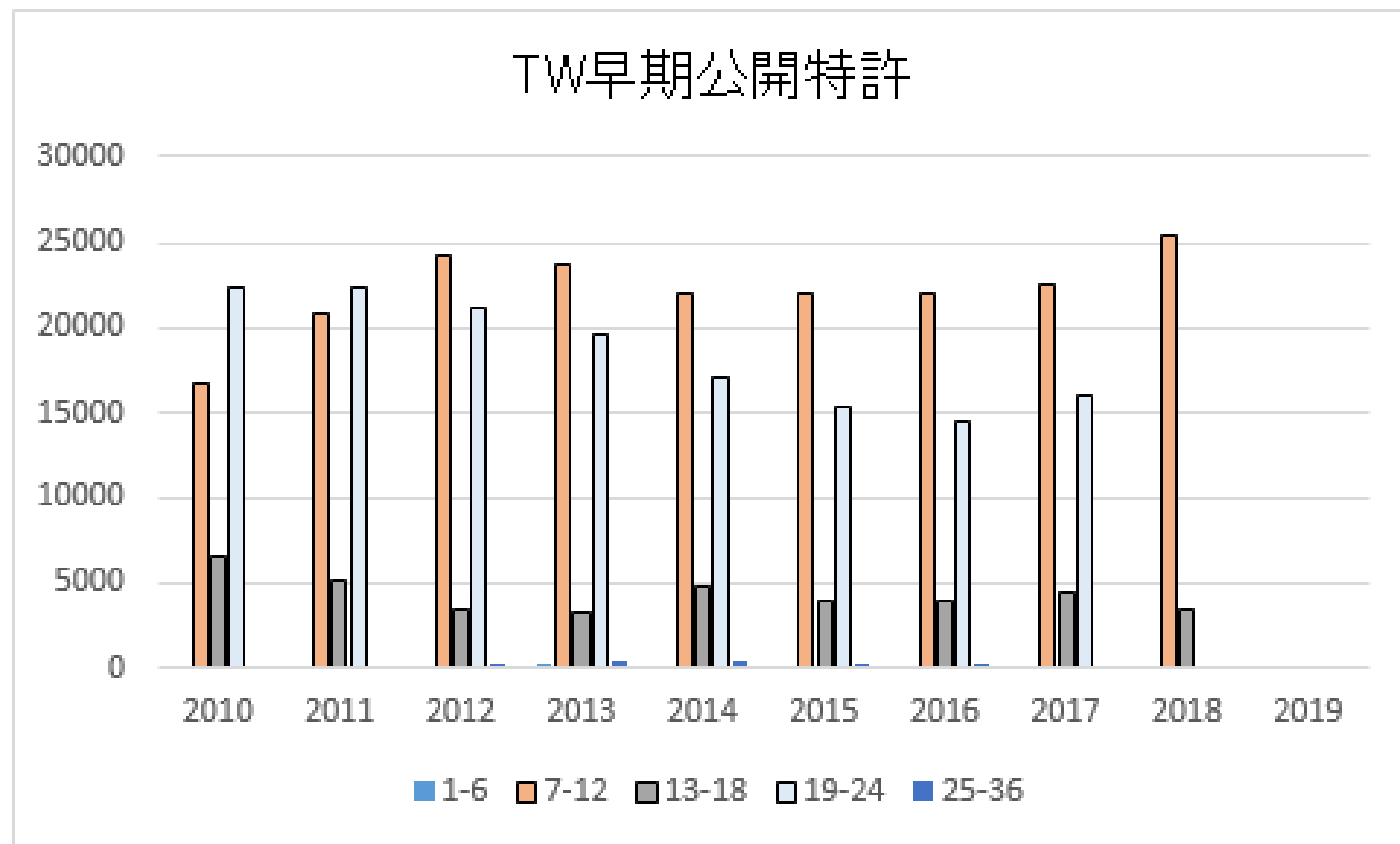


圖5. 意匠



参考情報: TWの早期公開特許



出願～6か月以内公開こそ少ないが、出願～12か月以内公開が18か月後公開(19-24か月)公開より多い。
日本は相変わらず公開のほとんどは18か月後公開(19-24か月)である。